# SuperKEKB に向けた入射器アップグレード LINAC UPGRADE FOR SUPERKEKB

夏井拓也<sup>#, A)</sup>,明本光生<sup>A)</sup>,荒川大<sup>A)</sup>,榎本收志<sup>A)</sup>,福田茂樹<sup>A)</sup>,古川和朗<sup>A)</sup>,本間博幸<sup>A)</sup>,飯田直子<sup>A)</sup>, 池田光男<sup>A)</sup>,門倉英一<sup>A)</sup>,柿原和久<sup>A)</sup>,紙谷琢哉<sup>A)</sup>,片桐広明<sup>A)</sup>,倉品美帆<sup>A)</sup>,松下英樹<sup>A)</sup>,松本修二<sup>A)</sup>, 松本利広<sup>A)</sup>,道園真一郎<sup>A)</sup>,三川勝彦<sup>A)</sup>,三浦孝子<sup>A)</sup>,宮原房史<sup>A)</sup>,中島啓光<sup>A)</sup>,中尾克已<sup>A)</sup>,大澤哲<sup>A)</sup>, 小川雄二郎<sup>A)</sup>,佐藤政則<sup>A)</sup>,設楽哲夫<sup>A)</sup>,白川明広<sup>A)</sup>,諏訪田剛<sup>A)</sup>,杉本寛<sup>A)</sup>,竹中たてる<sup>A)</sup>,矢野喜治<sup>A)</sup>, 横山和枝<sup>A)</sup>,吉田光宏<sup>A)</sup>,臧磊<sup>A)</sup>,周翔宇<sup>A)</sup>,一宮亮<sup>A)</sup>,佐藤大輔<sup>B)</sup>

Takuya Natsui <sup>#, A)</sup>, Mitsuo Akemoto <sup>A)</sup>, Yoshio Arakida <sup>A)</sup>, Dai Arakawa <sup>A)</sup>, Atsushi Enomoto <sup>A)</sup>, Shigeki Fukuda <sup>A)</sup>, Kazuro Furukawa <sup>A)</sup>, Hiroyuki Honma <sup>A)</sup>, Naoko Iida <sup>A)</sup>, Mitsuo Ikeda <sup>A)</sup>, Eiichi Kadokura <sup>A)</sup>, Kazuhisa Kakihara <sup>A)</sup>, Takuya Kamitani <sup>A)</sup>, Hiroaki Katagiri <sup>A)</sup>, Miho Kurashina <sup>A)</sup>, Hideki Matsushita <sup>A)</sup>, Shuji Matsumoto <sup>A)</sup>, Toshihiro Matsumoto <sup>A)</sup>, Shinichiro Michizono <sup>A)</sup>, Katsuhiko Mikawa <sup>A)</sup>, Takako Miura <sup>A)</sup>, Fusashi Miyahara <sup>A)</sup>, Hiromitsu Nakajima <sup>A)</sup>, Katsumi Nakao <sup>A)</sup>, Satoshi Ohsawa <sup>A)</sup>, Yujiro Ogawa <sup>A)</sup>, Masanori Satoh <sup>A)</sup>, Tetsuo Shidara <sup>A)</sup>, Akihiro

Shirakawa<sup>A)</sup>, Tsuyoshi Suwada<sup>A)</sup>, Hiroshi Sugimoto<sup>A)</sup>, Tateru Takenaka<sup>A)</sup>, Yoshiharu Yano<sup>A)</sup>, Kazue Yokoyama<sup>A)</sup>,

Mitsuhiro Yoshida<sup>A)</sup>, Lei Zang<sup>A)</sup>, Xiangyu Zhou<sup>A)</sup>, Ryo Ichimiya<sup>A)</sup>, Daisuke Satoh<sup>B)</sup>

<sup>A)</sup> High Energy Accelerator Research Organization (KEK/SOKENDAI)

<sup>B)</sup> Tokyo Institute of Technology

### Abstract

The injector linac of KEK is being upgraded for SuperKEKB. High-charge low-emittance electron and positron beams are required for SuperKEKB. The required injection electron beam parameters are 7.0 GeV at 5 nC 20 mm-mrad. A thermal cathode DC gun had been used for KEKB. However the DC gun could not make low-emittance beam. Thus low-emittance new RF gun is being developed. The positron beam will be injected to damping ring for emittance reduction. To obtain positron beam energy of 1.1 GeV at damping ring, primary electron beam energy will be reduced. In addition, charge of positron is 4 nC. Thus positron capture section is very important upgrade point. Some alignment technique has been studied since it is essential for emittance preservation.

## 1. はじめに

現在,KEK では SuperKEKB に向けた加速器全体 のアップグレードが行われている.SuperKEKB では 非常に高いルミノシティを得るための低エミッタン ス化によりダイナミックアパーチャーの減少とビー ム寿命の減少が起こる.これに対応して,電子陽電 子入射器は高電荷・低エミッタンス化が求められる. 表1に求められるビームパラメータを示す.図1が KEK 入射器の全体図である.ビームは電子陽電子と もに2バンチ運転が求められる.

Table 1: The required injection beam parameters	3
---	---

	1 7	<b>I</b>
	KEKB	SuperKEKB
	(e+/e-)	(e+/e-)
Charge [nC]	1 / 1	4 / 5
Emittance	2100 / 300	10 / 20
[mm-mrad]		

陽電子ビームは 10 nC のプライマリー電子ビーム をターゲットにて変換し,ダンピングリングで低エ ミッタンス化させて入射ビームとするが,電子ビー ムはダンピングリングを通さずに 5 nC, 20 mm-mrad

<sup>#</sup> takuya.natsui@kek.jp

の高電荷・低エミッタンスビームを入射器リニアッ クで直接作り出す必要がある.電子ビームに関して は、大幅な低エミッタンス化を実現するための電子 銃の開発が重要になる.また、陽電子ビームにおい ては、4 GeV の入射エネルギーを確保するため、 KEKB の構成よりも上流側にターゲットを移動させ る.すなわち、プライマリー電子ビームのエネル ギーが下がってしまうにもかかわらず、電荷量を4 倍にしなければいけない.このため陽電子収集効率 を向上させることが重要になる.さらに、低エミッ タンスを維持するためのアライメント技術の構築、 ビーム診断設備(BPM, Deflector)の開発が求められて いる.



Figure 1: SuperKEKB injector layout

## 2. 電子ビーム

#### 2.1 RF gun 開発

入射器の電子ビームには 3 つの役割があり,第一 は、①SuperKEKB HERへの低エミッタンス,高電荷 バンチの供給,第二に②SuperKEKB LERへの陽電子 ビーム生成用,高電荷バンチの供給,第三に、③放 射光リング (PF や AR) への電子供給である.従来, KEK 入射器では電子ビーム源として熱カソード DC gun が使用されてきたが,熱カソード DC gun で①に 要求される低エミッタンス電子ビームを供給するこ とは非常に難しい.そこで,高電荷低エミッタンス ビーム用の電子源として S-band フォトカソード RF gun の開発が行われている.②に関しては RF gun を 使用するか DC gun で行うかは今後判断する予定で ある.

フォトカソード RF gun は低エミッタンスビーム生 成に有用であり S-band では、BNL タイプと呼ばれる 1.5 cell の軸上結合型の空洞が一般的に使用されてき た<sup>(1)</sup>. しかし、BNL タイプの RF gun では通常 1 nC 程度のビーム発生が限界であり、5 nC もの高電荷に おいては空間電荷効果によりビームが発散してしま う.そうなると、後のビーム輸送においてエミッタ ンス保存とビーム集束の両方を考えなくてはいけな い.そこで RF gun の中でビームサイズが大きくなら ないような新しい空洞を持つ RF gun の設計を進めた. 昨年度までは、Disk and Washer (DAW)型の空洞を もつ RF gun を 3-2 セクターで試験運転を行い約 5 nC の電子ビーム発生を達成している<sup>[2]</sup>.

この DAW 型 RF gun の試験を通して軸外結合を 使った空洞の作る電場による集束作用の優位性が示 されたことやIr5Ceのカソード評価ができたことなど 様々な成果が得られたが, DAW 型 RF gun は理科大 の熱カソード RF gun を急遽フォトカソードに改良し たものにすぎず,高電荷低エミッタンスビーム発生 に特化しているとは言いがたい. 5 nC が計算上の高 電荷発生の上限であり、これは長期安定運転を求め られる RF gun としてはマージンが全くなく不安があ る.また,計算上でも発散角をもってビームが出力 されることが分かっており, ビームエネルギーが3 MeV 程と低いことと相まって、エミッタンスを保存 したままのビーム輸送を行うことを非常に困難にし ている. 故に, DAW 型 RF gun で得られた知見を生 かした高電荷低エミッタンスビーム発生に特化した 新たな RF gun の開発を行なっている.これは、新し い加速方式である擬似進行波型 RF gun と呼んでいる ものである<sup>[3]</sup>. DAW 型 RF gun では電極を近づけ電 場を集中させることで集束電場を作り出していたが, この DAW 方式では加速ギャップと加速ギャップの 間に長いドリフトスペースができてしまう. ここで 強い空間電荷効果によりビームが発散してしまう. 擬似進行波型 RF gun はこのデメリットを解消した設 計で、図2のように2つのサイドカップル空洞を一 つの軸上に互い違いに配置したものである. ここに π/2 だけ位相差を持った RF を投入することにより加 速ビームからは2つの定在波が等価的に進行波に見

える.このように各定在波空洞のドリフトスペース に当たる部分に他方の定在波空洞を配置することで 非常に効率よく加速電場を印加することができる.

また、ビームのエミッタンスに大きく影響するカ ソードセルでも非常に強い集束作用をもたせるよう な設計を行った.計算では 10 nC のビーム発生も可 能となっており、十分なマージンを残している.現 在は図3に示すように機械設計を終え、製作はロウ 付けの最終段階まで来ており、秋のコミッショニン グに使用することを目指している.



Figure 2: Quasi traveling wave side coupled cavities



Figure 3: Mechanical design of quasi traveling wave side coupled cavity RF gun

#### 2.2 RF gun 用レーザ開発

3-2 セクターの DAW 型 RF gun の試験のために, Nd:YAG の固体レーザの開発を行った.これは,30 psec の Semiconductor Saturable Absorber Mirror (SESAM)を使った52 MHz のモードロック発振器か らのパルスを取り出しマルチパスアンプで増幅して いる.レーザハットは入射器棟クライストロンギャ ラリーに構築し,地下のトンネル内の RF gun までは 約5 m の伝送距離になる.発振器は52 MHz である が linac の加速周波数 2856 MHz に精度よく同期させ るため,571.2 MHz (2856/5) で同期をとっている.

この発振器からのパルスを EO (Electro-optics)素子 を使ったパルスピッカーで1パルスだけ切り出し増 幅段に入射している.増幅にはポンプ用 LD(laser diode)と YAG 結晶が一体型となったモジュールを使 いマルチパスアンプを行なっている.最終の増幅は フラッシュランプを用いた増幅となっている.紫外 線への変換は BBO (β-BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)結晶を使って4倍高調 波を作り出している.30 psec の 266 nm 波長でパル スあたり4 mJ のレーザエネルギーを達成している. レーザの増幅段の写真とブロック図を図4に示す.



Figure 4: Nd: YAG laser system

また、今年度からは SuperKEKB の入射に使用す る A-1 セクターでの試験のために Yb-doped レーザー システムの運転を開始している[4].近年,帯域が広 く周波数領域で制御できるイッテルビウム (Ytterbium:Yb) 系レーザが注目されている. Yb 系 は3準位系で、上準位寿命が長く、エネルギー蓄積 効果が大きい. Nd 系に比べ, LD 直接励起でも, 励 起状態吸収が生じない.吸収波長が 915nm・940・ 976nm であり, 吸収帯域が広く, 蛍光帯域が 1020-1120nm であり、広い波長で増幅させることができ るので超短パルスレーザーを造りやすい. また吸収 波長と増幅波長の差が少ないため、非放射緩和過程 によるエネルギーの損失が低い. さらに、熱エネル ギーの放出が低いので、冷却装置が簡単という利点 がある.帯域が非常に広いということは時間方向の パルス整形を行う上で大きな利点になる. 極短パル スからグレーティングを使用してパルス伸張を行う 過程でパルス長の制御のみならずパルス内の時間方 向における整形も可能となる. この時間方向パルス 整形は縦方向ウェークの補償に有効である<sup>[5]</sup>.

図5に現在の Yb レーザーシステムの概要を示す. 発振器は 52 MHz のファイバー発振器である.ファ イバーを使った発振器は固体結晶を使ったものより 位相の安定度が高くフォトカソード RF gun 用に適し ている.発振器の中でのパルスは数百 fsec であるの で,グレーティングペアを使って 30 psec にパルス伸 張した後,ファイバーアンプにより増幅する.その 後パルスを切り出し Thin disk を使った再生増幅器と マルチパスアンプで数十 mJ までパルスを増幅し, BBO 結晶により 4 倍波を生成して RF gun にうちこ んでいる.



Figure 5: Yb laser system

## 3. 陽電子ビーム

3.1 フラックスコンセントレータ

SuperKEKB 計画に向けて陽電子ビーム強度増強の 方策の1つとして陽電子収集効率を向上させるため に、これまでの磁場強度 2 T の空芯型パルスコイル に代わるものとして,4T級のフラックスコンセン トレータ型パルスソレノイドの開発を進めている<sup>[6]</sup>. SLAC 及び IHEP で使用されたフラックスコンセント レータの設計に基づいて試作機を製作した.また Linac で使用されているクライストロンモジュレー タ電源を改造した試験用パルス電源を用いて、テス トスタンドで磁場分布測定や大電流通電試験を行っ ている.実用運転時に想定される最大電流値 12 kA に対して, テストスタンドでは現在のパルス電源で 最大使用可能な6kAまで到達しており放電の問題等 も特になく順調に通電試験が進んでいる. これと平 行してビーム運転用の実用機の製作を進めており, 今年10月よりテストスタンドで試験を行った後に ビームラインに設置して12月からの陽電子ビーム コミッショニングで使用する予定である.図6にフ ラックスコンセントレータの写真を示す.



Figure 6: Flux concentrator

#### 3.2 LAS による陽電子収集

フラックスコンセントレータの下流では LAS (Large aperture S-band linac)により陽電子を収集する. PCS (Positron Capture Section)では LAS は 2 m 管を計 6 本使う. ダンピングリングで要求されるエネル ギー幅の中にビームを収集する目的で最上流の 2 m 管は減速位相にビーム乗せる. 上流 2 本の LAS では 電力を上げ電界強度は 14 MeV/m とすることでサテ ライトバンチの抑制を行う. 下流の 4 本は 10 MeV/m とする. このような LAS のセクションで 120 MeV までの加速を行う.

#### 4. エミッタンス保存

SuperKEKB で要求されているビームエミッタンス を保存するために、入射器の各コンポーネントの設 置精度としてローカルで $\sigma = 0.1$  mm、グローバルに  $\sigma = 0.3$  mm が要求されている.入射器は最大直線部 で 500 m あり、これまでは全体を通しての高精度の アライメントする方法が確立されていなかった. 高精度レーザーアライメントシステムの開発を続けていたが、入射器の最大直線部のアライメントに必要な500m長の長基線レーザの安定化に成功した. アライメントの基準となる長基線にはHe-Neレーザー(10mW)を用いた.長基線を高安定化させるために新たなレーザ光学系を構築し、さらに計算機制御によるフィードバックを導入することによりレーザのポインティング安定性を飛躍的に高めた.この結果、500m直線部の終端におけるレーザの位置安定性は、±40 µm (1σ)レベルとなり入射器に要求されるアライメント精度を十分満足できることを確認した

また,ローカルなアライメントとしてはレーザー トラッカーを使ったアライメントも行なっている. 水管傾斜計を使った上下方向の位置測定も検討して いる.

入射器では低エミッタンスビーム輸送のため, ビームの位置測定精度 10µm 以下を目標としている. 入射器の BPM はすべてストリップライン型である が、現在使用しているオシロスコープを用いた信号 の読み出しシステムの位置測定精度は 50 μm 程度 であり、要求を満たしていない. そこで新しく BPM の読み出しシステムの開発を行っている.帯域制限 フィルタを基板としたアンダーサンプリング方式を 採用したシステムを開発し、実際にビームを使った 測定で分解能7µmを達成した<sup>[8]</sup>.また、これとは別 に2バンチ運転(96 ns 間隔)対応と BPM の各電極 にパルスを与えることが可能な校正パルス発生器を 備えた読み出しシステムの開発も行っている. 開発 の途中段階ではあるが、パルス信号を用いた測定で 10µm の分解能を達成しており、分解能向上のため の開発を継続している<sup>[9]</sup>.

また,ストリークカメラによるバンチ長計測や ディフレクターによるスライスビームサイズの測定 も計画している<sup>[10]</sup>.



Figure 7: Schedule

## 5. スケジュール

2014 年度末のメインリングへの入射試験に向けて 入射器では、本年度秋から小電流で、さらに来年度 秋には本格的なコミッショニングを行う.まず、9 月からは電子ビーム、11 月からは陽電子ビームのコ ミッショニングを行う.また、ダンピングリングを 含めたビーム入射は2015 年度の初めに予定している. その他の予定を含めた全体スケジュールを図7に示 す.

## 参考文献

- D. T. Palmer et al., "Microwave Measurements of the BNL/SLAC/UCLA 1.6 cell Photocathode RF Gun", SLAC-PUB-95-6799
- [2] T. Natsui et al., "DEVELOPMENT OF HIGH-CHARGE, LOW-EMITTANCE, RF GUN FOR SUPERKEKB", THPS02, 第9回加速器学会,大阪,20128月
- [3] T. Natsui et al., "Quasi Traveling Wave Side Couple RF Gun for SuperKEKB" Proceedings of IPAC2013, Shanghai, China, May, 2013
- [4] X. Zhou, et al., "SuperKEKB に向けた DAW 型 RF 電子 銃用 Yb 系ハイブリッドレーザーシステム", in these proceedings.
- [5] M. Yoshida et al., "SuperKEKB 入射器用低エミッタンス・高電荷電子ビームに向けたバンチ内時間構造制 御", in these proceedings.
- [6] T. Kamitani, "Positron Source", 18th KEKB Accelerator Review Committee, Tsukuba, Japan, March 4-6, 2013. <u>http://www-kekb.kek.jp/MAC/2013/</u>
- [7] T. Suwada et al., "KEKB入射器における高精度レーザー アライメントのための500m長レーザー長基線の伝送及 び安定性特性", in these proceedings.
- [8] M. Satoh, "SuperKEKB入射器へ向けたBPMデータ収集 系アップグレード (II)", in these proceedings
- [9] R. Ichimiya et al., "SuperKEKB に向けた電子・陽電子入 射器 Linac 用ビーム位置モニターの読み出しシステム 開発", in these proceedings.
- [10] J. Wang, "X-Band Deflectors Development at SLAC", X-Band RF Structure and Beam Dynamics Workshop - 44th ICFA Advanced Beam Dynamics Workshop, December 2008